

01; 05

© 1990 г.

МОДЕЛЬ ПЛАВЛЕНИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В ПУЗЫРЬКАХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ

*Д. Б. Кузьминов, В. Н. Черников, М. Ю. Герчиков,
А. М. Панеш, А. П. Симонов*

Введение

В 1984 г. в [^{1, 2}] было обнаружено, что атомы инертных газов (Ar и Xe), введенные в Al путем ионной бомбардировки при комнатной температуре, аккумулируются там в пузырьках в кристаллическом состоянии. Энергии ионов составляли 80 и 100 кэВ соответственно. Позже образование пузырьков, содержащих тяжелые инертные газы (ТИГ) в кристаллическом состоянии (Ar^к, Kr^к, Xe^к), регистрировалось различными группами исследователей и в других металлах (Me), причем не только после высокознергетического ионного облучения при 300 К [³⁻⁶], но также в результате облучения ионами с энергией менее 1 кэВ при повышенных температурах [⁷] (система Ar/Ni).

Несмотря на то что проделано большое число экспериментальных работ по изучению параметров пузырьков, содержащих ТИГ в кристаллическом состоянии (ТИГ^к), а также условий его плавления и кристаллизации, до сих пор отсутствуют адекватные модели соответствующих процессов. В предлагаемой работе изложена новая концепция, касающаяся условий протекания процесса плавления в сверхсжатых газовых пузырьках, а также предложен механизм, приводящий к переходу ТИГ^к во флюидное состояние и являющийся, на наш взгляд, в большинстве случаев доминирующим. С его помощью объяснен ряд экспериментальных фактов, наблюдавшихся при плавлении и кристаллизации Ar, Kr и Xe в пузырьках Al, Ni, Mo.

1. Экспериментальная часть

Облучение тонких монокристаллических фольг Ni с плоскостью поверхности типа {112} проводилось при 300 К ионами Ar⁺ с энергией 30 кэВ дозой $2 \cdot 10^{20}$ ион·м⁻², после чего они электролитически утоньшались со стороны, обратной облучавшейся. Полученные таким образом препараты анализировались в просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) EM-400T «PHILIPS» при ускоряющем напряжении 120 кВ и температуре, близкой к комнатной. Одна серия образцов исследовалась сразу после облучения; образцы второй серии после облучения нагревались в условиях сверхвысокого безмасляного вакуума до температуры 820 К со скоростью 10 К·с⁻¹, затем охлаждались и только после этого утоньшались и анализировались в ПЭМ.

Изучение препаратов в ПЭМ в фазовом контрасте показало, что в приповерхностных слоях облученных образцов Ni содержатся мелкие полости со средним диаметром $d=3.0$ нм (рис. 1, а) и высокой объемной плотностью. Из анализа картин микродифракции (рис. 1, б) и темнопольных изображений, как и в [⁷], был сделан вывод о том, что аргон в этих полостях в матрице кристаллизуется в ГЦК решетку со средним параметром решетки $a_{Ar}=0.470 \pm 0.003$ нм; этому соответствует плотность атомов Ar^к $\rho_{Ar}=(3.9 \pm 0.2) \cdot 10^{28}$ ат. · м⁻³. Согласно экстрапо-

поляционному уравнению состояний (ЭУС) Рончи [8], давление аргона в пузырьках с такой атомной плотностью составляет ≈ 6 ГПа. Вместе с тем лапласово давление для поры диаметром $d=3.0$ нм в Ni не превышает 2.7 ГПа. Соответ-

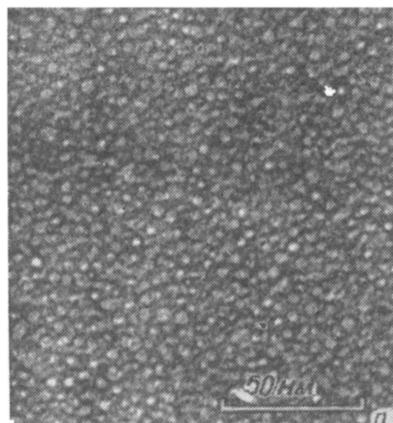
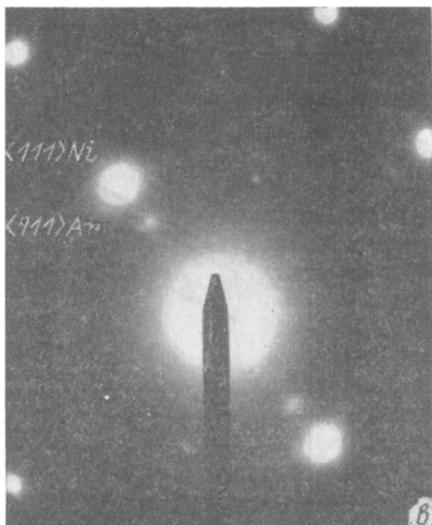


Рис. 1. Результаты анализа в ПЭМ приповерхностного слоя Ni, облученного ионами Ar^+ ($E=30$ кэВ, $D=2 \cdot 10^{20}$ ион· м^{-2} , $T=300$ К).

a — светлопольное изображение в фазовом контрасте до нагрева, недофокусировка ($\Delta f=-0.8$ мкм); *б* — картина микродифракции до нагрева, ориентационное соотношение $\{112\} \text{Ni} \parallel \{111\} \text{Ar}$; *в* — то же, что и на рис. 1, *б*, но после нагрева.



ственными выявленные нами в первой серии фольг пузырьки являются сверххрупкими.

Анализ микроэлектронограмм, относящихся ко второй серии образцов (рис.1, *в*), показал, что результатом их однократного нагрева до $T=820$ К

Таблица 1

Свойства кристаллических ТИГ Ar , Kr , Xe и диаметры пузырьков в Al , Ni , Mo . Экспериментальные данные

Система ТИГ/Ме	Диаметр пузырька d , нм	Свойства кристаллического ТИГ			Ссылки
		параметр решетки a , нм	плотность упаковки, м^{-3}	температура плавления, К	
Ar/Ni	3.0	0.470 ± 0.003	$3.9 \cdot 10^{28}$	—	Настоящая работа
Ar/Al	2.7 ± 0.5	0.516 ± 0.005	$3.2 \cdot 10^{28}$	730 ± 20	[5]
Kr/Ni	3.0	0.5	$3.2 \cdot 10^{28}$	850 ± 25	[3]
Kr/Al	3.2	0.534 ± 0.003	$2.63 \cdot 10^{28}$	620	[6]
Kr/Mo	4.5*	0.51	$3.2 \cdot 10^{28}$	920	[4]
Xe/Al	3.6 ± 0.5	0.604 ± 0.004	$1.9 \cdot 10^{28}$	670	[5]

* Величина вычислена из микроэлектронограммы, данной в [4].

явилось возрастание величины параметра решетки Ar^* до среднего значения $a_{\text{Ar}}^*=0.495 \pm 0.005$ нм, что соответствует плотности $\rho_{\text{Ar}}=(3.3 \pm 0.1) \cdot 10^{28}$ ат. м⁻³. Внутреннее давление в этих пузырьках по ЭУС Рончи составило $\rho_{\text{Ar}}^* \simeq 2.4$ ГПа. С учетом данных Эванса и Мазе о фазовом переходе Kr^* во флюидное состояние в системе Kr/Ni при $T=825-875$ К можно предположить, что температура нагрева второй группы образцов (820 К) была достаточна также и для плавления Ar^* в наблюдавшихся нами пузырьках. Тогда увеличение параметра решетки и соответствующее падение гидростатического давления Ar^* можно связать с прохождением процессов плавления аргона в пузырьках (в ходе нагрева до 820 К) и повторной его кристаллизации при последующем охлаждении. Эти результаты, а также ряд известных из литературы экспериментальных данных по другим системам ТИГ*/Ме сведены в табл. 1.

2. Обсуждение результатов

На рис. 2 представлены рассчитанные нами зависимости давление—температура $p(T)$ для Ar^* , Kr^* , Xe^* , отражающие изменение среднего давления ТИГ в пузырьках при повышении температуры металлической матрицы Al, Ni, Mo.

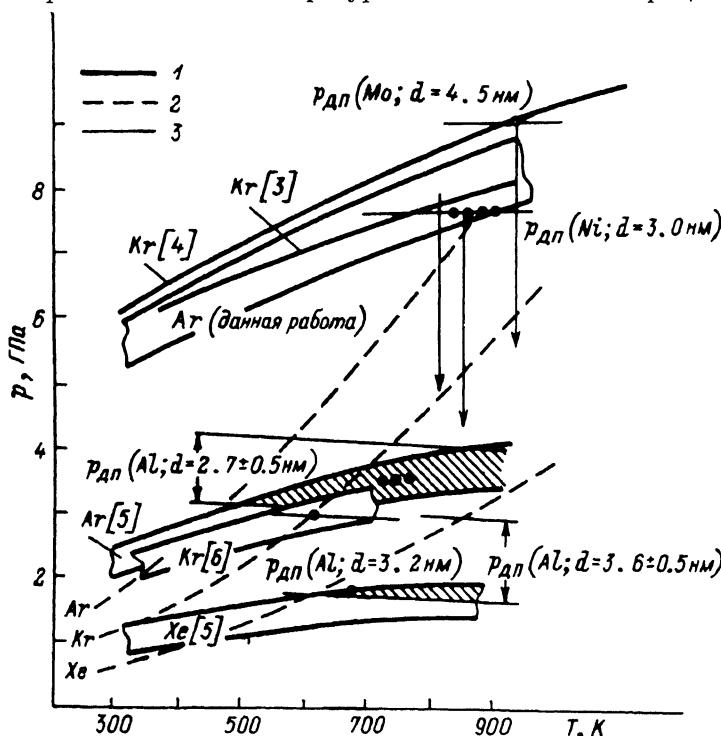


Рис. 2. Сводный график расчетных зависимостей в координатах $p-T$.

1 — уравнения состояний различных ТИГ по Рончи [8], исходя из данных табл. 1; 2 — кривые плавления $p=p(T)/m$ для Ar , Kr , Xe по Саймону [9]; 3 — кривые критического давления для эжекций дислокационных петель $p_{\text{ДП}}=p_{\text{ДП}}(T)$ по Грикву [11], исходя из данных табл. 1. Абсциссы точек, отмеченные кружками, отвечают экспериментально зафиксированным значениям температур плавления ТИГ.

Расчет этих зависимостей выполнялся по упоминавшемуся ЭУС Рончи, исходя из данных цитированных в табл. 1 работ, т. е. в качестве отправных брались значения $\bar{a}_{\text{тиг}}$, зафиксированные при 300 К. При этом учитывалось термическое расширение металла, в силу чего кривые $p(T)$ являются «квазизохорами». Точность расчета последних зависит от погрешности определения $\bar{a}_{\text{тиг}}$. Для работ, где ошибка не указана, зависимости $p(T)$ обозначены сплошными линиями; для других, где точность определения $\bar{a}_{\text{тиг}}$ сообщается, эти зависимости представлены полосами, ограниченными непрерывными «коридорными» линиями. Абсциссы точек, обозначенных на рис. 2 кружками, соответствуют интерва-

лам и значениям температур плавления ТИГ T_m , зафиксированным экспериментально.

Кривые плавления ТИГ в координатах $p-T$ хорошо описываются уравнением Саймона [9]

$$p = A(T - T_0)c + B, \quad (1)$$

где A , B , c , T_0 — эмпирические константы, значения которых для Ar, Kr и Xe приведены в табл. 2.

На рис. 2 кривые плавления ТИГ $p(T)/m$ обозначены штриховыми линиями. Казалось бы, что температура плавления данного ТИГ в пузырьке может быть определена как абсцисса точки пересечения рассчитанной ранее зависимости $p(T)$ с кривой плавления Саймона (1). Но, как легко убедиться, в большинстве рассматриваемых случаев температуры плавления, определенные таким образом, существенно отличаются от экспериментально регистрируемых значений T_m , причем отклонения наблюдаются как в большую, так и в меньшую сторону. Ниже предлагаются общая концепция, позволяющая понять физические причины этих расхождений, и модель, в рамках которой можно с хорошей точностью предсказать температуры фазовых переходов.

Таблица 2
Коэффициенты A , B , c и T_0 в уравнении Саймона [9]

Инертный газ	A	B , МПа	c	T_0 , К
Ar	0.499	148.4	1.43	30.18
Kr	0.336	177.8	1.44	38.10
Xe	0.571	129.6	1.30	95.45

Фазовый переход ТИГ^{*} во флюидное состояние возможен лишь в условиях увеличения объема, который он занимает. Согласно уравнению Клайперона—Клаузуса, это увеличение составляет

$$\Delta V_{\text{фп}} = \frac{H_m}{T_m} \left(\frac{dp}{dT} \right)_m^{-1}, \quad (2)$$

где H_m — теплота плавления, причем отношение H_m/T_m , как и для всех простых веществ, составляет 10.5 ± 2.1 Дж/моль·К [10], а $(dp/dT)_m$ — наклон кривой плавления в точке $T=T_m$.

С другой стороны, по достижении газом, содержащимся в замкнутой полости, параметров плавления (p_m , T_m) ТИГ^{*} начнет перегреваться, а фазовый переход будет задерживаться. Вероятно, именно это наблюдалось в работе [11]. Уместно заметить, что значения $\Delta V_{\text{фп}}$ для пузырьков ТИГ, оцененные с помощью (2), значительно превосходят термическое увеличение объема пузырьков, которое могло бы иметь место при перегреве, на сотни градусов.

Увеличение объема газосодержащей полости в ходе нагрева в общем случае возможно двумя путями: 1) в результате захвата термических вакансий или 2) путем эжекций дислокационных петель (ДП) междоузельного типа, что реализуется в условиях «вакансационного дефицита». Условия вакансационного дефицита возникают либо в случае недостаточной подвижности самих вакансий, либо в результате медленного продвижения вакансационных фронтов в зону имплантации ТИГ от вакансационных источников по аналогии с тем, как это происходит при отжиге в системе He/Ni, изучавшейся в [12, 13]. Авторы [13] считают, что в матрице в зоне торможения ионов инертного газа действительная концентрация вакансий c_v может оказаться в результате нагрева и формирования газовой пористости ниже равновесного для данной температуры значения c_v^* , причем это различие может некоторое время сохраняться даже при высоких температурах отжига (выше 1100 К для Ni [13]) и способствовать таким образом сохранению сверхравновесного давления в первичных пузырьках. Какой из двух механизмов увеличения объема пузырьков, способных привести к плавлению ТИГ^{*}, сработает

при нагреве, зависит и от материала матрицы, и от начального давления ТИГ^к в пузырьках (определяется условиями облучения), и от скорости нагрева.

Наблюдавшееся в [3] плавление Kr^к в пузырьках Ni матрицы в принципе могло бы реализоваться, как предполагают авторы, за счет аккумуляции термических вакансий. Однако в свете сказанного выше условие высокой подвижности вакансий может рассматриваться лишь как необходимое для реализации 1-го механизма. С другой стороны, плавление ТИГ в пузырьках наблюдалось и при температурах, при которых реализация 1-го механизма невозможна, например, в системах Kr/Mo, Ni (табл. 1). В этих случаях эжекция пузырьками дислокационных петель в результате роста давления при нагреве является монопольным механизмом увеличения объема пузырьков, что подтверждается приводимыми ниже количественными оценками.

Согласно [14], процесс эмиссии междуузельных дислокационных петель происходит по достижении давления

$$p_{\text{ДП}} = 2\gamma/R + (\mu b/2\pi(1-\nu)) R_{\text{ДП}} \ln \frac{R_{\text{ДП}}}{r_0}, \quad (3)$$

где R — радиус пузырька, $R_{\text{ДП}}$ — радиус ДП ($R_{\text{ДП}} \simeq R$), μ — модуль сдвига, b — модуль вектора Бюргерса, r_0 — радиус ядра дислокации ($r_0 \simeq b$), γ — поверхностное натяжение металла, ν — коэффициент Пуассона.

В результате эмиссии ДП объем пузырька увеличивается на величину $\Delta V_{\text{ДП}} = -\pi R^2 b$, внутреннее давление и плотность атомов аргона в пузырьке падают, и это может привести к плавлению ТИГ. Действительно, для всех систем ТИГ/Ме, указанных в табл. 1, выполняется условие $V_{\text{ДП}} = (3-4)\Delta V_{\text{ДП}}$ (в расчете на один пузырек). Таким образом, возможной температурой плавления ТИГ является та, при которой в пузырьке достигается критическое давление $p_{\text{ДП}}$. Для систем, параметры которых указаны в табл. 1, T_m можно определить как абсциссу точек пересечения зависимостей $p(T)$, рассчитанных с помощью ЭУС Рончи, с соответствующими функциями $p_{\text{ДП}} = p_{\text{ДП}}(T)$, рассчитанными с помощью (3) с учетом термического расширения металла. На рис. 2 они показаны сплошными тонкими линиями или полосами, ограниченными тонкими линиями, в зависимости от точности, с которой известны исходные диаметры пузырьков (табл. 1). Значения констант металлов γ , μ , b и ν были взяты из [15].

Оказалось, что все экспериментальные значения температур плавления (табл. 1) попадают в температурные интервалы, определенные по предложенному нами механизму (рис. 2). Согласно той же модели, расчетное уменьшение давления в пузырьках за счет эмиссии ДП (в отсутствие перегрева) достаточно для перевода ТИГ во флюидное состояние. Действительно, каждая из вертикальных стрелок на рис. 2, длина которой отвечает разности давлений ТИГ в пузырьке до и после эмиссии ДП (для систем Ar, Kr/Ni и Kr/Mo) и которая оканчивается на результирующем давлении, пересекает соответствующие кривые плавления Ar и Kr. Имеющиеся несоответствия расчетных и экспериментально зарегистрированных величин T_m , не превышающие 50 К, можно объяснить погрешностями определения исходных параметров. Видно, что уже небольшая ошибка в определении среднего диаметра пузырька (± 0.5 нм) или параметра решетки ТИГ^к ($\pm 0.003-0.005$ нм) приводит к существенным погрешностям определения T_m . Кроме того, для Al априори нельзя исключить возможности увеличения объема пузырьков за счет термических вакансий, т. е. по первому механизму плавления.

С позиций данной модели можно предложить иную трактовку экспериментальных результатов работы [3]. В этой работе отмечалось, что, во-первых, температуры плавления Kr и его последующей кристаллизации (в работе она не указана) не совпадают; во-вторых, в результате нагрева и охлаждения облученного Ni происходит уменьшение плотности атомов Kr^к в пузырьках от $\simeq 3.2 \cdot 10^{28}$ до $\simeq 2.7 \cdot 10^{28}$ ат.⁻¹·м⁻³. По нашей модели при плавлении Kr^к в [3] ($T_m = 825-875$ К) давление в пузырьках падает до $\simeq 4$ ГПа (рис. 2). По мере последующего охлаждения среднее давление флюидного газа в пузырьках будет уменьшаться в соответствии с траекторией в координатах $p-T$, определяемой ЭУС Рончи до пересечения с кривой плавления в точке, абсцисса которой отве-

чает температуре вторичной кристаллизации $T_c = 730$ К. Указанная температура действитель но ниже экспериментально определенной в [3] температуры плавления T_m Kr^x. Уменьшение давления криптона происходит за счет увеличения объема пузырька на величину $\Delta V_{\text{дн}} \approx 1.8 \text{ нм}^3$ и соответствующего уменьшения атомной плотности газа в ≈ 1.13 раз. При этом она становится равной $\approx 2.8 \cdot 10^{28}$ ат.·м⁻³, что сравнимо с экспериментально определенным в [3] значением.

Аналогичные рассуждения, примененные к анализу поведения системы Ar/Ni, приводят к заключению о том, что после вторичной кристаллизации в результате охлаждения до 300 К атомная плотность Ar в пузырьках в Ni должна составлять $\approx 3.5 \cdot 10^{28}$ ат.·м⁻³. Это значение также весьма близко к величине плотности, полученной из опыта, а именно $(3.3 \pm 0.1) \cdot 10^{28}$ ат.·м⁻³ (см. раздел 1).

Заключение

В настоящей работе предложена простая количественная модель, согласно которой в условиях вакансационного дефицита плавление кристаллического тяжелого инертного газа в сверхравновесном пузырьке происходит с ростом температуры в результате скачкообразного увеличения его объема путем эмиссии дислокационной петли. Знание среднего радиуса пузырьков в данном металле и постоянной решетки закристаллизованного в них газа позволяет с высокой точностью определить температуру плавления ТИГ^x в пузырьках, результирующее давление газа, а также судить о возможности вторичной кристаллизации, ее температуре и атомной плотности перекристаллизованного газа.

Список литературы

- [1] Templier C., Jaouen C., Riviere J.-P. et al. // C. R. Acad. Sci. Paris, 1984. Vol. 299. P. 613—615.
- [2] Vom Felde A., Fink J., Muller-Heinzerling Th. et al. // Phys. Rev. Lett. 1984. Vol. 53. P. 922—925.
- [3] Evans J. H., Mazey D. J. // J. Phys. F. 1985. Vol. 15. P. 21—26.
- [4] Evans J. H., Mazey D. J. // Scripta Metallurgica. 1985. Vol. 19. P. 621—623.
- [5] Donnelly S. E., Rossouw C. J. // Nucl. Inst. & Meth. 1986. Vol. B13. P. 485—489.
- [6] Hashimoto I., Yorikawa H., Mitsuya H. et al. // J. Nucl. Mater. 1987. Vol. 149. P. 69—73.
- [7] Кузьминов Д. Б., Черников В. Н., Герчиков М. Ю. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. Вып. 21. С. 1952—1957.
- [8] Ronchi C. // J. Nucl. Mater. 1981. Vol. 96. P. 314—328.
- [9] Crawford R. K. // Rare Gas Solids / Ed. M. L. Klein, J. A. Venables. London: Acad. Press, 1977. Vol. 1. P. 663.
- [10] Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А. А. Равделя, А. М. Пономаревой. Л.: Химия, 1983. 109 с.
- [11] Rossouw C. J., Donnelly S. E. // Phys. Rev. Lett. 1985. Vol. 55. N 27. P. 2960—2963.
- [12] Marcock N., Perryman L. J., Goodhew P. J. // J. Nucl. Mater. 1987. Vol. 149. N 3. P. 296—301.
- [13] Черников В. Н., Захаров А. П., Казанский П. Р. // ДАН СССР. 1989. Т. 304. № 4. С. 870—874.
- [14] Greenwood G. W., Foreman A. J. A., Rimmer D. E. // J. Nucl. Mater. 1959. Vol. 4. P. 305—309.
- [15] Donnelly S. E. // Rad. Eff. 1985. Vol. 90. P. 1—47.

Научно-исследовательский
физико-химический институт
им. Л. Я. Карпова
Москва

Поступило в Редакцию
7 июля 1989 г.